

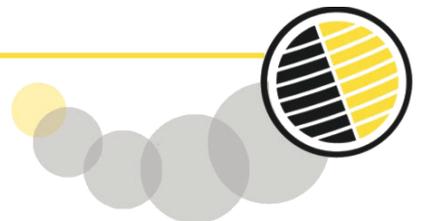


Sorgente al plasma AC GGK-LF

Generatore del plasma compatto 500W@50kHz,
sinusoidale.

Sistema misura integrato, impedenze 500-
1000Ω. Ideale per sputtering dielettrico e CVD.

Scarica stabile, controllo digitale avanzato."



Generatore nella versione black box ideale per chi voglia controllare l'alimentatore via PC o PLC. Il sistema fornisce 500 watt@50 KHz, ed e' possibile l'adattamento di impedenza da 250 a 1500ohm.

In alcune applicazioni, questo generatore può essere utilizzato in sostituzione all' RF, con costi sensibilmente inferiori e con minori problemi di messa a punto.

Questo generatore rappresenta una alternativa ideale nelle applicazioni di Glow Discharge, rispetto alle sorgenti DC ad alta tensione.

La scarica è molto più stabile e non si ha la for-

mazione di cariche localizzate. Può essere utilizzato per lo sputtering di target di materiali conduttivi o per applicazioni in PECVD.

SETTORI DI UTILIZZO

Produzione sistemi PVD e PECVD

Ricerca & Sviluppo

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Glow discharge.(in sostituzione dei convenzionali sistemi in DC)

Processi di deposizione PECVD

Alimentazione di piccoli catodi Sputtering

Sorgente di BIAS in sistemi ICP.

Processi di pulizia ed attivazione in plasma.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Molto compatte: 345Px160Lx120A mm. Peso: 4 kg ca
Connessione	Diretta all'elettrodo, non è richiesta alcuna Rete d'Adattamento.
Potenza	500W disponibile in un range d'impedenza di 2 a 1 senza la necessità di regolazione delle pre-
Sistema di misurazione	Accurato e completo: tensione RMS, DC self bias, letture della potenza disponibili sul
Arc detection	Rilevazione e spegnimento attivo degli archi (soppressione)
Protezioni	Sovratemperatura, sovratensione, limitazione della potenza d'uscita

REV-01B-ITA

